

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ



МАГНА ТМ 29

Назначение:

Нанесение многокомпонентных и многослойных металлических или диэлектрических тонких плёнок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Обработка подложек: $\varnothing 76$ мм, $\varnothing 100$ мм, $\varnothing 150$ мм;
- Две шлюзовые камеры для загрузки – выгрузки подложек;
- Конвейерная система транспортирования подложек из кассеты в кассету;
- Предварительный нагрев подложек с помощью лампового нагревателя и их очистка с помощью источника ионов;
- Безмасляная (сухая) откачка на базе форвакуумного и турбомолекулярного или криогенного насосов;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 30 кВт;
- Площадь занимаемая одной установкой ~ 10 м².

